

PVD 设备系列

特征

ORIGIN（奥力进）的PVD设备系列是一种精密的PVD（物理气相沉积）光学多层薄膜真空镀膜系统。可以应用于各种生产现场和研究，实验中，例如薄膜沉积，光学镜片生产，滤光片生产，前面板玻璃生产，半导体生产，新材料开发，物质合成，物质隔离，离子清洗，离子辅助沉积，真空电子束焊接等多个领域。利用最新技术进行设计，确保高生产效率和产品质量提升。

构成为真空室，真空泵，冷却装置，电气控制，气压控制，真空压力控制，沉积膜厚度控制，气体量控制，E-beam source（电子枪，电子枪电源，坩埚和坩埚衬套），Ion-beam source（离子枪和离子枪电源）。

- * ORIGIN（奥力进）的PVD设备系列可按订单生产。
- * 一些布局可能无法安装，下订单前请咨询。
- * 当与其他厂家产品混合使用时，我们无法保证产品的性能。

OC-1700



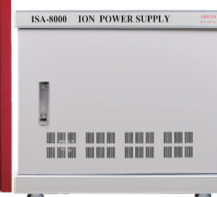
OE-1700E



ISA-7000



ISA-8000



规格

Chamber inside dimensions (单位: Ø)	600, 750, 1200, 1500, 1600, 2000, 2050 or Option
EB-power supplies	ISA-7000 or Option (可以按订单规格定制.)
Crucible	1, 4, 8, 12, Etc pocket to 25cc or Option
Ion-power supplies	ISA-8000 or Option (可以按订单规格定制.)
Chamber main material & Coating jig	SUS304 & Substrate rotation system or Option
View port	150 Diameter tempered glass include shutter, 1 to 3 Port or Option
Uniformity mask	Connector type SUS alloy
Vacuum measuring	"Granville-phillips" GP-307 or Option
Deposition controller	"Inficon" IC-6 or Option
Chamber inside shield	Separation type SUS alloy
Gas supplies	2 to 3 MFC purity 99.9%
Pressure control, Coating control	Auto, Manual
Pressure (Approximately)	Ultimate 6.0E-7 Torr, Working 2.0E-5 Torr
High vacuum pump	Option
Booster vacuum pump	Option
Rotary vacuum pump	Option
Poly cold	Option
Substrate heater	Halogen heater or Option
Main controller	Option
Line power	220Vac and 380Vac 3ph 50Hz / 60Hz \pm 5% Approximately 80KVA
Nonlinearity	\pm 2% FS
Vibration in the workspace	Approximately X,Y,Z < 0.2G Less than
Operating temperation & Humidity	17 to 25°C, 20 to 70% RH

